



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103135870 A

(43) 申请公布日 2013.06.05

(21) 申请号 201210479914.1

(22) 申请日 2012.11.22

(30) 优先权数据

2011-255764 2011.11.24 JP

(71) 申请人 日东电工株式会社

地址 日本大阪府

(72) 发明人 津野直树 鹰尾宽行 高田胜则

猪饲和宏

(74) 专利代理机构 北京林达刘知识产权代理事

务所(普通合伙) 11277

代理人 刘新宇 李茂家

(51) Int. Cl.

G06F 3/044 (2006.01)

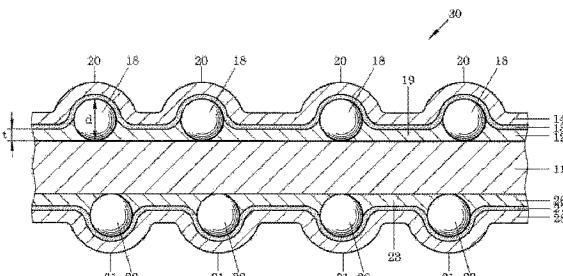
权利要求书2页 说明书8页 附图3页

(54) 发明名称

透明导电性薄膜

(57) 摘要

本发明提供一种透明导电性薄膜，该透明导电性薄膜(30)具有：由非晶性聚合物薄膜形成的基材(11)和、第1硬涂层(12)、第1透明导体层(13)、第1金属层(14)和、第2硬涂层(26)、第2透明导体层(27)、第2金属层(28)。第1硬涂层(12)包含粘结剂树脂(19)和多个颗粒(18)。第2硬涂层(26)包含粘结剂树脂(23)和多个颗粒(22)。第1金属层(14)在表面具有多个凸部(20)。第2金属层(28)在表面具有多个凸部(21)。



1. 一种透明导电性薄膜, 其具有:

由非晶性聚合物薄膜形成的基材, 和

在所述基材的一个面上依次形成的第1硬涂层、第1透明导体层、以及第1金属层, 和

在所述基材的另一面上依次形成的第2硬涂层、第2透明导体层、以及第2金属层,

所述第1硬涂层含有粘结剂树脂和多个颗粒,

所述颗粒的直径或者高度比所述粘结剂树脂的平坦区域的厚度更大,

所述第1金属层在其表面具有多个凸部, 所述凸部起因于所述第1硬涂层所含的所述多个颗粒。

2. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第1金属层的表面的所述凸部的分布密度为100个/mm²~2000个/mm²。

3. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第2硬涂层含有粘结剂树脂和多个颗粒,

所述第2硬涂层中所含的所述颗粒的直径或者高度比所述第2硬涂层中所含的所述粘结剂树脂的平坦区域的厚度更大,

所述第2金属层在其表面具有多个凸部, 所述凸部起因于所述第2硬涂层所含的所述多个颗粒。

4. 根据权利要求3所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第2金属层的表面的所述凸部的分布密度为100个/mm²~2000个/mm²。

5. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 形成所述非晶性聚合物薄膜的材料为聚环烯烃或聚碳酸酯。

6. 根据权利要求5所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述非晶性聚合物薄膜的面内的双折射率为0~0.001, 面内的双折射率的偏差为0.0005以下。

7. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 形成所述第1硬涂层中所含的所述颗粒的材料为丙烯酸类聚合物、有机硅聚合物、苯乙烯聚合物、或无机二氧化硅。

8. 根据权利要求3所述的透明导电性薄膜, 其中, 形成所述第2硬涂层中所含的所述颗粒的材料为丙烯酸类聚合物、有机硅聚合物、苯乙烯聚合物、或无机二氧化硅。

9. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第1硬涂层中所含的所述颗粒为球状, 其直径为1μm~5μm。

10. 根据权利要求3所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第2硬涂层中所含的所述颗粒为球状, 其直径为1μm~5μm。

11. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第1硬涂层中所含的所述多个颗粒的含量为所述第1硬涂层的0.05重量%~3重量%。

12. 根据权利要求3所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第2硬涂层中所含的所述多个颗粒的含量为所述第2硬涂层的0.05重量%~3重量%。

13. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第1金属层的表面的算术平均粗糙度Ra为0.005μm~0.05μm, 最大高度Rz为0.5μm~2.5μm。

14. 根据权利要求3所述的透明导电性薄膜, 其中, 所述第2金属层的表面的算术平均粗糙度Ra为0.005μm~0.05μm, 最大高度Rz为0.5μm~2.5μm。

15. 根据权利要求1所述的透明导电性薄膜, 其中, 形成所述第1透明导体层的材料和

形成所述第 2 透明导体层的材料为铟锡氧化物、铟锌氧化物、或者氧化铟 - 氧化锌复合氧化物中的任一种。

16. 根据权利要求 1 所述的透明导电性薄膜，其中，形成所述第 1 金属层的材料和形成所述第 2 金属层的材料为铜或银。

透明导电性薄膜

技术领域

[0001] 本发明涉及用于电容型触摸面板等的透明导电性薄膜。

背景技术

[0002] 以往的透明导电性薄膜具备基材、分别形成在基材的两面上的透明导体层、形成在各透明导体层上的金属层(专利文献1:日本特开2011-60146)。将以往的透明导电性薄膜用于电容型触摸面板时,对金属层进行加工、在触摸输入区域的外侧形成金属布线。由此,电容型触摸面板的边框部分可以较窄。但是,以往的透明导电性薄膜使用由聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(结晶性聚合物薄膜)形成的基材。聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜(结晶性聚合物薄膜)的双折射率大,根据部位的不同而双折射率也不同。因此以往的透明导电性薄膜产生彩虹色的颜色不均匀(颜色的浓淡)。聚对苯二甲酸乙二醇酯薄膜的双折射率为通常0.01左右。

[0003] 非晶性聚合物薄膜与结晶性聚合物薄膜相比,双折射率较小并且均匀。因此透明导电性薄膜的颜色不均匀可通过使用由非晶性聚合物薄膜形成的基材而消除。但是,非晶性聚合物薄膜比结晶性聚合物薄膜更脆弱,因此表面容易受到损伤。进而,在透明导电性薄膜的两面具有金属层的情况下,卷取透明导电性薄膜使其为筒状时,存在相邻的透明导电性薄膜的金属层彼此产生压接这样的问题。压接是指在压力作用下固定,有时也指粘连。

[0004] 现有技术文献

[0005] 专利文献

[0006] 专利文献1:日本特开2011-60146号公报

发明内容

[0007] 发明要解决的问题

[0008] 本发明的目的在于,解决在使用由非晶性聚合物薄膜形成的基材的情况下,基材的表面容易受到损伤这样的问题。进而,本发明的目的在于,解决相邻的透明导电性薄膜的金属层彼此产生压接这样的问题。

[0009] 用于解决问题的方案

[0010] (1) 本发明的透明导电性薄膜具有由非晶性聚合物薄膜形成的基材、和在基材的一个面上依次形成的第1硬涂层、第1透明导体层、第1金属层。另外,本发明的透明导电性薄膜具有在基材的另一面上依次形成的第2硬涂层、第2透明导体层、第2金属层。第1硬涂层含有粘结剂树脂和多个颗粒。颗粒的直径或者高度比粘结剂树脂的平坦区域的厚度大。第1金属层在其表面具有起因于第1硬涂层中所含的多个颗粒的多个凸部。

[0011] (2) 本发明的透明导电性薄膜中,第1金属层的表面的凸部的分布密度为100个/mm²~2000个/mm²。

[0012] (3) 本发明的透明导电性薄膜中,第2硬涂层含有粘结剂树脂和多个颗粒。第2硬涂层中含有的颗粒的直径或者高度比第2硬涂层中含有的粘结剂树脂的平坦区域的厚度

大。第 2 金属层在其表面具有起因于第 2 硬涂层所含的多个颗粒的多个凸部。

[0013] (4) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 2 金属层的表面的凸部的分布密度为 100 个 / mm^2 ~2000 个 / mm^2 。

[0014] (5) 本发明的透明导电性薄膜中, 形成非晶性聚合物薄膜的材料为聚环烯烃或聚碳酸酯。

[0015] (6) 本发明的透明导电性薄膜中, 非晶性聚合物薄膜的面内的双折射率为 0~0.001, 面内的双折射率的偏差为 0.0005 以下。

[0016] (7) 本发明的透明导电性薄膜中, 形成第 1 硬涂层中所含的颗粒的材料为丙烯酸类聚合物、有机硅聚合物、苯乙烯聚合物、或无机二氧化硅。

[0017] (8) 本发明的透明导电性薄膜中, 形成第 2 硬涂层中所含的颗粒的材料为丙烯酸类聚合物、有机硅聚合物、苯乙烯聚合物、或无机二氧化硅。

[0018] (9) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 1 硬涂层中所含的颗粒为球状, 其直径为 1 μm ~5 μm 。

[0019] (10) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 2 硬涂层中所含的前述颗粒为球状, 其直径为 1 μm ~5 μm 。

[0020] (11) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 1 硬涂层中所含的多个颗粒的含量为第 1 硬涂层的 0.05 重量 %~3 重量 %。

[0021] (12) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 2 硬涂层中所含的多个颗粒的含量为第 2 硬涂层的 0.05 重量 %~3 重量 %。

[0022] (13) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 1 金属层的表面的算术平均粗糙度 Ra 为 0.005 μm ~0.05 μm , 最大高度 Rz 为 0.5 μm ~2.5 μm 。

[0023] (14) 本发明的透明导电性薄膜中, 第 2 金属层的表面的算术平均粗糙度 Ra 为 0.005 μm ~0.05 μm , 最大高度 Rz 为 0.5 μm ~2.5 μm 。

[0024] (15) 本发明的透明导电性薄膜中, 形成第 1 透明导体层的材料和形成第 2 透明导体层的材料为钢锡氧化物、钢锌氧化物、或者氧化钢 - 氧化锌复合氧化物的任一种。

[0025] (16) 本发明的透明导电性薄膜中, 形成第 1 金属层的材料和形成第 2 金属层的材料为铜或银。

发明的效果

[0027] 根据本发明, 可解决透明导电性薄膜的颜色不均匀、表面的损伤、以及金属层的压接的问题。

附图说明

[0028] 图 1 为本发明的透明导电性薄膜(第 1 例)的截面示意图。

[0029] 图 2 为本发明的透明导电性薄膜(第 2 例)的截面示意图。

[0030] 图 3 为本发明的透明导电性薄膜(第 3 例)的截面示意图。

具体实施方式

透明导电性薄膜

[0032] 本发明的透明导电性薄膜 10 (第 1 例)如图 1 所示, 具备基材 11、第 1 硬涂层 12、

第1透明导体层13、以及第1金属层14。第1硬涂层12、第1透明导体层13、以及第1金属层14依次层叠在基材11的一个面(图1中为上表面)上。本发明的透明导电性薄膜10还具备第2硬涂层15、第2透明导体层16、以及第2金属层17。第2硬涂层15、第2透明导体层16、以及第2金属层17依次层叠在基材11的另一面(图1中为下表面)上。

[0033] 基材11由非晶性聚合物薄膜形成。第1硬涂层12包含粘结剂树脂19和多个颗粒18。颗粒18的直径d比粘结剂树脂19的平坦区域(没有颗粒18的区域)的厚度t大。因此第1硬涂层12的表面的高度在有颗粒18的区域高、在仅有粘结剂树脂19的平坦区域低。第1透明导体层13和第1金属层14沿着第1硬涂层12的表面层叠。因此,第1金属层14的表面形状反映第1硬涂层12的表面形状,在有颗粒18的位置具有凸部20。

[0034] 第2硬涂层15包含粘结剂树脂23。第2硬涂层15的表面形状与第1硬涂层12的表面形状不同,是平坦的。第2透明导体层16和第2金属层17以沿着第2硬涂层15的方式层叠。因此,第2金属层17的表面形状反映第2硬涂层15的表面形状,是平坦的。

[0035] 本发明的透明导电性薄膜10的基材11使用双折射率小并且均匀的非晶性聚合物薄膜。因此可消除本发明的透明导电性薄膜10中的颜色不均匀。另外,本发明的透明导电性薄膜10由于第1硬涂层12和第2硬涂层15覆盖在基材11的表面上,因此可防止基材11的表面受到损伤。进而由于第1金属层14的表面具有凸部20,因此在卷绕透明导电性薄膜10成筒状时,第1金属层14与第2金属层17成为点接触。由此可避免第1金属层14与第2金属层17产生压接。

[0036] 为了避免本发明的透明导电性薄膜10的损伤、压接,可利用辊对辊工艺(roll to roll process)来制造长条的透明导电性薄膜10。另外,可以以长条的透明导电性薄膜10卷绕成的透明导电性薄膜筒的形态进行保存、运输、以及加工。因此本发明的透明导电性薄膜10生产率高。

[0037] 本发明的透明导电性薄膜30(第2例)如图2所示,具备基材11、第1硬涂层12、第1透明导体层13、以及第1金属层14。第1硬涂层12、第1透明导体层13以及第1金属层14在基材11的一个面上依次层叠。本发明的透明导电性薄膜30还具备第2硬涂层26、第2透明导体层27、以及第2金属层28。第2硬涂层26、第2透明导体层27、以及第2金属层28在基材11的另一面依次层叠。

[0038] 基材11由非晶性聚合物薄膜形成。第1硬涂层12包含粘结剂树脂19和多个颗粒18。颗粒18的直径d比粘结剂树脂19的平坦区域(没有颗粒18的区域)的厚度t大。因此第1硬涂层12的表面的高度在有颗粒18的区域高、在仅有粘结剂树脂19的平坦区域低。第1透明导体层13和第1金属层14沿着第1硬涂层12的表面层叠。因此,第1金属层14的表面形状反映第1硬涂层12的表面形状,在有颗粒18的位置具有凸部20。

[0039] 第2硬涂层26包含粘结剂树脂23和多个颗粒22。颗粒22的直径比粘结剂树脂23的平坦区域(没有颗粒22的区域)的厚度大。第2硬涂层26的表面形状与第1硬涂层12的表面形状类似,在有颗粒22的区域高、在仅有粘结剂树脂23的平坦区域低。第2透明导体层27和第2金属层28以沿着第2硬涂层26的表面的方式层叠。因此,第2金属层28的表面形状反映第2硬涂层26的表面形状,在有颗粒22的位置具有凸部21。

[0040] 本发明的透明导电性薄膜30的基材11中,使用双折射率小并且均匀的非晶性聚

合物薄膜。因此本发明的透明导电性薄膜 30 中可消除颜色不均匀。另外，本发明的透明导电性薄膜 30 由于第 1 硬涂层 12 和第 2 硬涂层 26 覆盖在基材 11 的表面上，因此可防止基材 11 的表面受到损伤。进而由于第 1 金属层 14 具有凸部 20、第 2 金属层 28 具有凸部 21，因此卷绕透明导电性薄膜 30 成筒状时，第 1 金属层 14 与第 2 金属层 28 成为点接触。其结果，可避免第 1 金属层 14 与第 2 金属层 28 产生压接。对于防压接效果，与第 1 例的透明导电性薄膜 10 相比，第 2 例的透明导电性薄膜 30 更高。

[0041] 本发明的透明导电性薄膜 30 为了避免损伤、压接，可通过辊对辊工艺制造长条的透明导电性薄膜 30。另外，可以以长条的透明导电性薄膜 30 卷绕成的透明导电性薄膜筒的形态进行保管、运输、以及加工。因此本发明的透明导电性薄膜 30 生产率高。

[0042] 本发明的透明导电性薄膜 40 (第 3 例)如图 3 所示，具备基材 11、第 1 硬涂层 12、第 1 折射率调整层 24 (index matching layer)、第 1 透明导体层 13、以及第 1 金属层 14。第 1 硬涂层 12、第 1 折射率调整层 24、第 1 透明导体层 13、以及第 1 金属层 14 依次层叠在基材 11 的一个面上。本发明的透明导电性薄膜 40 还具备第 2 硬涂层 26、第 2 折射率调整层 25、第 2 透明导体层 27、和第 2 金属层 28。第 2 硬涂层 26、第 2 折射率调整层 25、第 2 透明导体层 27、以及第 2 金属层 28 依次层叠在基材 11 的另一面上。

[0043] 基材 11 由非晶性聚合物薄膜形成。第 1 硬涂层 12 包含粘结剂树脂 19 和多个颗粒 18。颗粒 18 的直径 d 比粘结剂树脂 19 的平坦区域(没有颗粒 18 的区域)的厚度 t 大。因此第 1 硬涂层 12 的表面的高度在有颗粒 18 的区域高、在仅有粘结剂树脂 19 的平坦区域低。第 1 折射率调整层 24、第 1 透明导体层 13、以及第 1 金属层 14 沿着第 1 硬涂层 12 的表面层叠。因此，第 1 金属层 14 的表面形状反映第 1 硬涂层 12 的表面形状，在有颗粒 18 的位置具有凸部 20。

[0044] 第 2 硬涂层 26 包含粘结剂树脂 23 和多个颗粒 22。颗粒 22 的直径比粘结剂树脂 23 的平坦区域(没有颗粒 22 的区域)的厚度大。第 2 硬涂层 26 的表面形状与第 1 硬涂层 12 的表面形状类似，在有颗粒 22 的区域高、在仅有粘结剂树脂 23 的平坦区域低。第 2 折射率调整层 25、第 2 透明导体层 27 以及第 2 金属层 28 以沿着第 2 硬涂层 26 的表面的方式层叠。因此，第 2 金属层 28 的表面形状反映第 2 硬涂层 26 的表面形状，在有颗粒 22 的位置具有凸部 21。

[0045] 本发明的透明导电性薄膜 40 的基材 11 使用双折射率小并且均匀的非晶性聚合物薄膜。因此可消除本发明的透明导电性薄膜 40 中的颜色不均匀。另外，本发明的透明导电性薄膜 40 由于第 1 硬涂层 12 和第 2 硬涂层 26 覆盖在基材 11 的表面上，因此可防止基材 11 的表面受到损伤。进而由于第 1 金属层 14 具有凸部 20、第 2 金属层 28 具有凸部 21，因此卷绕透明导电性薄膜 40 成筒状时，第 1 金属层 14 与第 2 金属层 28 成为点接触。其结果，可避免第 1 金属层 14 与第 2 金属层 28 产生压接。

[0046] 本发明的透明导电性薄膜 40 为了避免损伤、压接，可通过辊对辊工艺制造长条的透明导电性薄膜 40。另外，可以以长条的透明导电性薄膜 40 卷绕成的透明导电性薄膜筒的形态进行保管、运输、以及加工。因此本发明的透明导电性薄膜 40 生产率高。

[0047] 基材

[0048] 基材 11 由非晶性聚合物薄膜形成。由于非晶性聚合物薄膜比起结晶性聚合物薄膜双折射小并且均匀，可消除本发明的透明导电性薄膜中的颜色不均匀。用于本发明的非

晶性聚合物薄膜的面内的双折射率优选为 $0\sim0.001$, 进一步优选为 $0\sim0.0005$ 。用于本发明的非晶性聚合物薄膜的面内的双折射率的偏差优选为 0.0005 以下, 进一步优选为 0.0003 以下。前述双折射率和其偏差可通过选择适宜的种类的非晶性聚合物薄膜而达成。

[0049] 形成非晶性聚合物薄膜的材料没有特别的限制, 优选为聚环烯烃或聚碳酸酯。由非晶性聚合物薄膜形成的基材 11 的厚度例如为 $20 \mu m\sim200 \mu m$ 。非晶性聚合物薄膜也可以在表面具有例如由聚氨酯形成的薄的易粘接层(未图示)。

[0050] 硬涂层

[0051] 第 1 硬涂层 12 形成在基材 11 的一个面上, 第 2 硬涂层 15、26 形成在基材 11 的另一个面上。第 1 硬涂层 12 包含粘结剂树脂 19 和多个颗粒 18。多个颗粒 18 无规地分布在粘结剂树脂 19 中。第 2 硬涂层 15 包含粘结剂树脂 23。第 2 硬涂层 26 包含粘结剂树脂 23 和多个颗粒 22。

[0052] 第 1 硬涂层 12 中所含的多个颗粒 18 例如由丙烯酸类聚合物、有机硅聚合物、苯乙烯聚合物、或无机二氧化硅形成。颗粒 18 的形状例如为球状。颗粒 18 为球状时, 其直径 d 优选为 $1 \mu m\sim5 \mu m$ 、进一步优选为 $1.5 \mu m\sim3.5 \mu m$ 。颗粒 18 不为球状时(例如为不定形), 其高度(与基材 11 的表面垂直的方向的尺寸)优选为 $1 \mu m\sim5 \mu m$ 、进一步优选为 $1.5 \mu m\sim3.5 \mu m$ 。颗粒 18 为球状时, 其优选的直径 d 为最频粒径(表示粒径分布的最大值的粒径)是优选的。颗粒 18 不为球状时(例如为不定形时)、该优选的高度为最频粒径(表示粒径分布的极大值的粒径)是优选的。关于第 1 硬涂层 12 的颗粒 18 的含量, 从防止产生压接的观点来看, 为第 1 硬涂层 12 的重量的 0.05 重量 % ~3 重量 % 是合适的。

[0053] 第 1 硬涂层 12 的粘结剂树脂 19 包含例如基于紫外线、电子射线的固化性树脂组合物。固化性树脂组合物优选包含使丙烯酸缩水甘油酯系聚合物与丙烯酸进行加成反应而得到的聚合物。或者, 固化性树脂组合物优选包含多官能丙烯酸酯聚合物(季戊四醇、二季戊四醇等)。固化性树脂组合物还包含聚合引发剂。第 1 硬涂层 12 的仅有粘结剂树脂 19 的区域(没有颗粒 18 的区域)的厚度 t 优选为 $0.5 \mu m\sim3 \mu m$ 、进一步优选为 $0.8 \mu m\sim3 \mu m$ 。对于第 2 硬涂层 15 的粘结剂树脂 23 也同样。另外, 对于第 2 硬涂层 26 的粘结剂树脂 23 和颗粒 22 也同样。

[0054] 第 1 硬涂层 12 的表面的颗粒 18 为球状时, 颗粒 18 的直径 d 比仅有粘结剂树脂 19 的区域的厚度 t 大, 因此具有起因于颗粒 18 的突出部。第 1 硬涂层 12 的表面的颗粒 18 不为球状时, 颗粒 18 的高度比仅有粘结剂树脂 19 的区域的厚度 t 大, 因此具有起因于颗粒 18 的突出部。第 1 硬涂层 12 的表面的突出部的位置与颗粒 18 的位置基本一致。颗粒 18 的位置无规地分布, 因此第 1 硬涂层 12 的表面的突出部的位置也无规地分布。第 1 硬涂层 12 的突出部的形状和分布密度可通过改变颗粒 18 的形状、尺寸、以及含量来调整。第 1 硬涂层 12 的突出部的分布密度优选为 100 个 / $mm^2\sim2000$ 个 / mm^2 、更优选为 100 个 / $mm^2\sim1000$ 个 / mm^2 。第 2 硬涂层 26 的突出部的分布密度也同样。

[0055] 第 1 硬涂层 12 的表面的算术平均粗糙度 R_a 优选为 $0.005 \mu m\sim0.05 \mu m$, 最大高度 R_z 优选为 $0.5 \mu m\sim2.5 \mu m$ 。第 2 硬涂层 26 的表面的算术平均粗糙度 R_a 、以及最大高度 R_z 也同样。

[0056] 透明导体层

[0057] 没有第 1 折射率调整层 24 时, 第 1 透明导体层 13 形成在第 1 硬涂层 12 的表面上。

有第1折射率调整层24时，第1透明导体层13形成在第1折射率调整层24的表面上。第1透明导体层13由在可见光区域(380nm~780nm)中透射率高(80%以上)、且每单位面积的表面电阻值(单位： Ω / \square :ohms per square)为 $500 \Omega / \square$ 以下的层形成。第1透明导体层13的厚度优选为 $10\text{nm} \sim 100\text{nm}$ 、更优选为 $10\text{nm} \sim 50\text{nm}$ 。第1透明导体层13例如由铟锡氧化物(ITO: Indium Tin Oxide)、铟锌氧化物、或者氧化铟-氧化锌复合氧化物的任一种形成。第2透明导体层16形成在第2硬涂层15的表面上。第2透明导体层16的物性、材料与第1透明导体层13相同。没有第2折射率调整层25时，第2透明导体层27形成在第2硬涂层26的表面上。有第2折射率调整层25时，第2透明导体层27形成在第2折射率调整层25的表面上。第2透明导体层27的物性、材料与第1透明导体层13相同。

[0058] 金属层

[0059] 第1金属层14形成在第1透明导体层13的表面上。第1金属层14在将本发明的透明导电性薄膜用于例如触摸面板时，用于在触摸输入区域的外侧形成布线。关于形成第1金属层14的材料，有代表性的是铜、银，也可使用除此以外的导电性优异的任意的金属。第1金属层14的厚度优选为 $50\text{nm} \sim 500\text{nm}$ 、更优选为 $100\text{nm} \sim 300\text{nm}$ 。第2金属层17形成在第2透明导体层16的表面上。第2金属层17的用途、材料、厚度与第1金属层14相同。另外，第2金属层28形成在第2透明导体层27的表面上。第2金属层28的用途、材料、厚度与第1金属层14相同。

[0060] 第1金属层14的表面与第1硬涂层12的表面形状类似，具有无规地分布的凸部20。凸部20的分布密度优选为 $100 \text{个}/\text{mm}^2 \sim 2000 \text{个}/\text{mm}^2$ 、更优选为 $100 \text{个}/\text{mm}^2 \sim 1000 \text{个}/\text{mm}^2$ 。第1金属层14的表面的算术平均粗糙度Ra优选为 $0.005 \mu \text{m} \sim 0.05 \mu \text{m}$ 、更优选为 $0.005 \mu \text{m} \sim 0.03 \mu \text{m}$ 。第1金属层14的表面的最大高度Rz优选为 $0.5 \mu \text{m} \sim 2.5 \mu \text{m}$ 、更优选为 $0.5 \mu \text{m} \sim 2.0 \mu \text{m}$ 。第1金属层14的表面的算术平均粗糙度Ra和最大高度Rz可通过调整颗粒18的形状、尺寸、以及含量来改变。第2金属层28的表面反映第2硬涂层26的表面形状，具有无规地分布的凸部21。第2金属层28的表面粗糙度与第1金属层14的表面粗糙度相同。

[0061] 卷绕本发明的透明导电性薄膜10时，第1金属层14的表面与第2金属层17的表面接触。第1金属层14的表面有无规地分布的凸部20，第2金属层17的表面是平坦的。因此，第1金属层14的表面与第2金属层17的表面成为点接触。由此，可防止第1金属层14与第2金属层17的压接。卷绕本发明的透明导电性薄膜30、40时，第1金属层14的表面与第2金属层28的表面接触。第1金属层14的表面有无规地分布的凸部20，第2金属层28的表面有无规地分布的凸部21。因此，第1金属层14的表面与第2金属层28的表面成为点接触。由此，可防止第1金属层14与第2金属层28的压接。第1金属层14与第2金属层28的防压接效果比第1金属层14与第2金属层17的防压接效果大。

[0062] 折射率调整层

[0063] 本发明的透明导电性薄膜40(第3例)如图3所示，在第1硬涂层12与第1透明导体层13之间具有第1折射率调整层24(index matching layer)。另外，在第2硬涂层26与第2透明导体层27之间具有第2折射率调整层25。关于第1折射率调整层24，在后工序中将第1透明导体层13图案化后，使有第1透明导体层13的部分和没有其的部分的反射率之差减小，使第1透明导体层13的图案难以辨认。第2折射率调整层25的功能也

相同。

[0064] 第1折射率调整层24的折射率优选设定为在第1硬涂层12的折射率与第1透明导体层13的折射率之间的数值。形成第1折射率调整层24的材料例如为氨基甲酸酯系聚合物。第1折射率调整层24的厚度优选为5nm~150nm。对于第2折射率调整层25也同样。

[0065] 制造方法

[0066] 对本发明的透明导电性薄膜10(第1例)的制造方法的一个例子进行说明。在由非晶性聚合物薄膜形成的基材11的一个面上涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂19和多个颗粒18。接着在基材11的另一面上涂布包含粘结剂树脂23的硬涂剂。接着对基材11的两面的硬涂剂照射紫外线而使硬涂剂固化,形成第1硬涂层12和第2硬涂层15。接着利用溅射法等在第1硬涂层12的表面上依次层叠第1透明导体层13和第1金属层14。第1透明导体层13和第1金属层14可通过在溅射装置内设置透明导体层用靶和金属层用靶而连续地层叠。对第2硬涂层15的表面也同样地操作,依次层叠第2透明导体层16和第2金属层17。

[0067] 对本发明的透明导电性薄膜30(第2例)的制造方法的一个例子进行说明。在由非晶性聚合物薄膜形成的基材11的一个面上涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂19和多个颗粒18。接着在基材11的另一面上涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂23和多个颗粒22。接着对基材11的两面的硬涂剂照射紫外线而使硬涂剂固化,形成第1硬涂层12和第2硬涂层26。接着利用溅射法等在第1硬涂层12的表面上依次层叠第1透明导体层13和第1金属层14。第1透明导体层13和第1金属层14可通过在溅射装置内设置透明导体层用靶材和金属层用靶材而连续地层叠。对第2硬涂层26的表面也同样地操作,依次层叠第2透明导体层27和第2金属层28。

[0068] 对本发明的透明导电性薄膜40(第3例)的制造方法的一个例子进行说明。在由非晶性聚合物薄膜形成的基材11的一个面上涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂19和多个颗粒18。接着在基材11的另一面上涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂23和多个颗粒22。接着对基材11的两面的硬涂剂照射紫外线而使硬涂剂固化,形成第1硬涂层12和第2硬涂层15。接着在第1硬涂层12的表面涂布折射率调整剂、在第2硬涂层15的表面涂布折射率调整剂。接着对第1硬涂层12上的折射率调整剂和第2硬涂层15上的折射率调整剂照射紫外线而使折射率调整剂固化,形成第1折射率调整层24和第2折射率调整层25。接着利用溅射法等在第1折射率调整层24的表面上依次层叠第1透明导体层13和第1金属层14。第1透明导体层13和第1金属层14可通过在溅射装置内设置透明导体层用靶和金属层用靶而连续地层叠。对第2折射率调整层25的表面也同样地操作,依次层叠第2透明导体层27和第2金属层28。

[0069] 实施例

[0070] 在由环烯烃聚合物形成的长条薄膜基材11的一个面上涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂19和多个颗粒18。在长条薄膜基材11的另一面涂布硬涂剂。硬涂剂包含粘结剂树脂23和多个颗粒22。对硬涂剂照射紫外线,使硬涂剂固化形成第1硬涂层12和第2硬涂层26。长条薄膜基材11为日本ZEON Corporation. 制造的“ZEONOR”(注册商标)、厚度为100μm、面内的双折射率为0.0001。颗粒18、22为积水树脂公司制造的“SSX105”、为直径3μm的球状。颗粒18、22的材质为交联丙烯酸类·苯乙烯系树脂。粘结剂树脂19、

23 为 DIC 公司制造的“UNIDIC”。粘结剂树脂 19, 23 的材质为多官能聚丙烯酸酯。第 1 硬涂层 12 的表面具有起因于多个颗粒 18 的无规地分布的凸部、和颗粒 18 与颗粒 18 之间的基本平坦的区域。凸部的分布密度为 205 个 / mm^2 。颗粒 18 与颗粒 18 之间的基本平坦的区域的厚度 t 为 1 μm 。第 1 硬涂层 12 的表面的算术平均粗糙度 Ra 为 0.008 μm 、最大高度 Rz 为 0.8 μm 。第 2 硬涂层 26 的表面的凸部的分布密度、算术平均粗糙度 Ra、最大高度 Rz 与第 1 硬涂层 12 的这些值相同。

[0071] 将形成了第 1 硬涂层 12 和第 2 硬涂层 26 的长条薄膜基材投入卷取式溅射装置，在第 1 硬涂层 12 的表面连续层叠厚度 27nm 的铟锡氧化物层(第 1 透明导体层 13)和厚度 200nm 的铜层(第 1 金属层 14)。第 1 金属层 14 的表面的算术平均粗糙度 Ra 为 0.02 μm 、最大高度 Rz 为 1.6 μm 。接着，在第 2 硬涂层 26 的表面连续层叠厚度 27nm 的铟锡氧化物层(第 2 透明导体层 27)和厚度 200nm 的铜层(第 2 金属层 28)。第 2 金属层 28 的表面的算术平均粗糙度 Ra 为 0.02 μm 、最大高度 Rz 为 1.6 μm 。

[0072] 评价

[0073] 上述的透明导电性薄膜 30 由于在基材 11 中使用了双折射率极小的聚环烯烃薄膜，因此未见颜色不均匀。另外，由于设置了第 1 硬涂层 12 和第 2 硬涂层 26，因此未产生表面损伤。进而即使卷绕透明导电性薄膜 30，由于第 1 金属层 14 的凸部 20 和第 2 金属层 28 的凸部 21，第 1 金属层 14 与第 2 金属层 28 成为点接触，未产生压接。因此，本发明的透明导电性薄膜 30 可通过辊对辊工艺操作，生产率高。

[0074] 测定方法

[0075] 双折射率

[0076] 薄膜基材 11 的面内的双折射率使用相位差计(王子计测机器公司制造的 KOBRA-WPR)，利用波长 590nm 的光来测定。

[0077] 表面粗糙度

[0078] 表面粗糙度 Ra、Rz 使用光学式表面光度计(Veeco Instruments 公司制造的 Optical Profilometer NT3300) 来测定。

[0079] 膜厚

[0080] 不足 1 μm 的膜厚使用透射型电子显微镜(日立制作所制造的 H-7650) 观察截面，不进行测定。基材 11 的厚度使用膜厚计(Peacock 公司制造的 Digital Dial Gauge DG-205) 来测定。

[0081] 产业上的可利用性

[0082] 本发明的透明导电性薄膜的用途没有限制。本发明的透明导电性薄膜可在电容型触摸面板、特别是投影型的电容型触摸面板中适宜地使用。

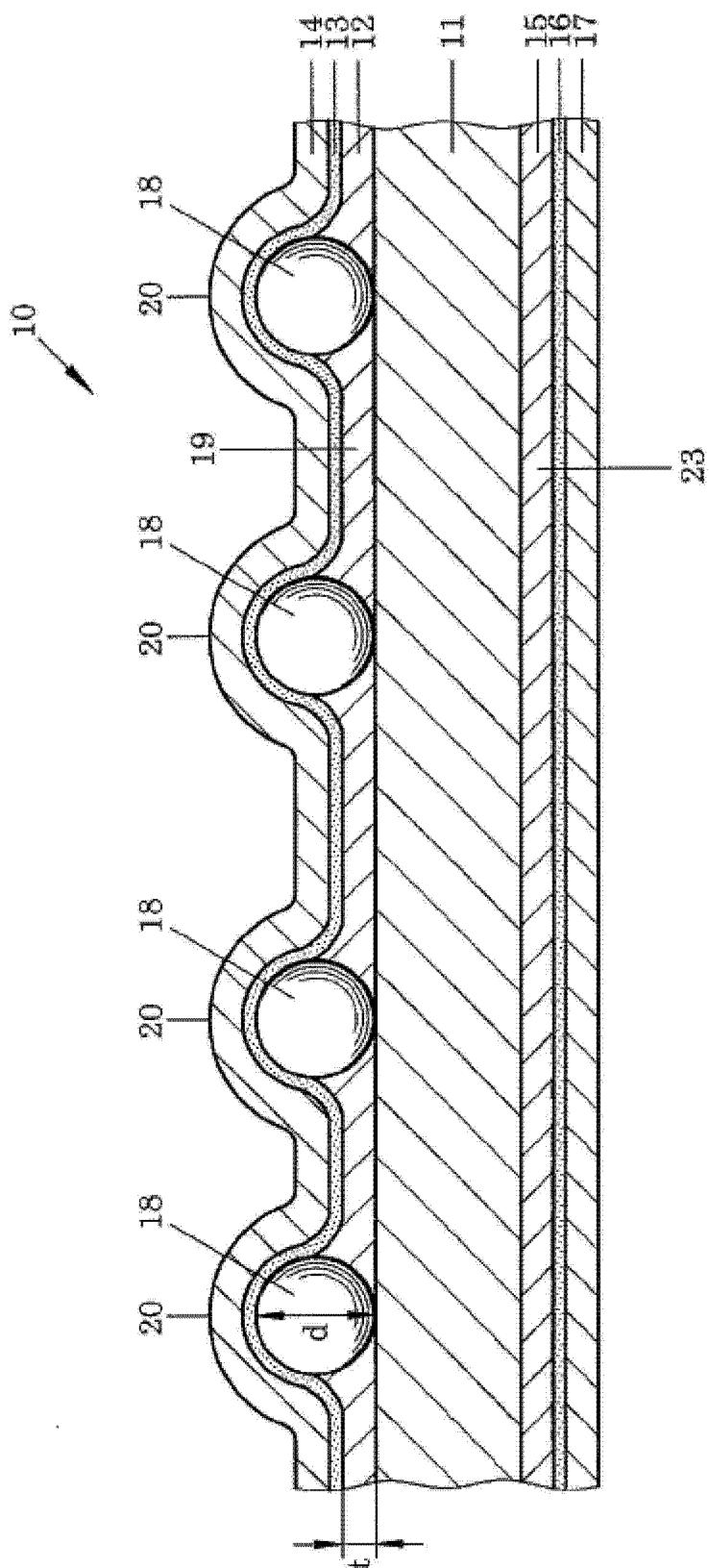


图 1

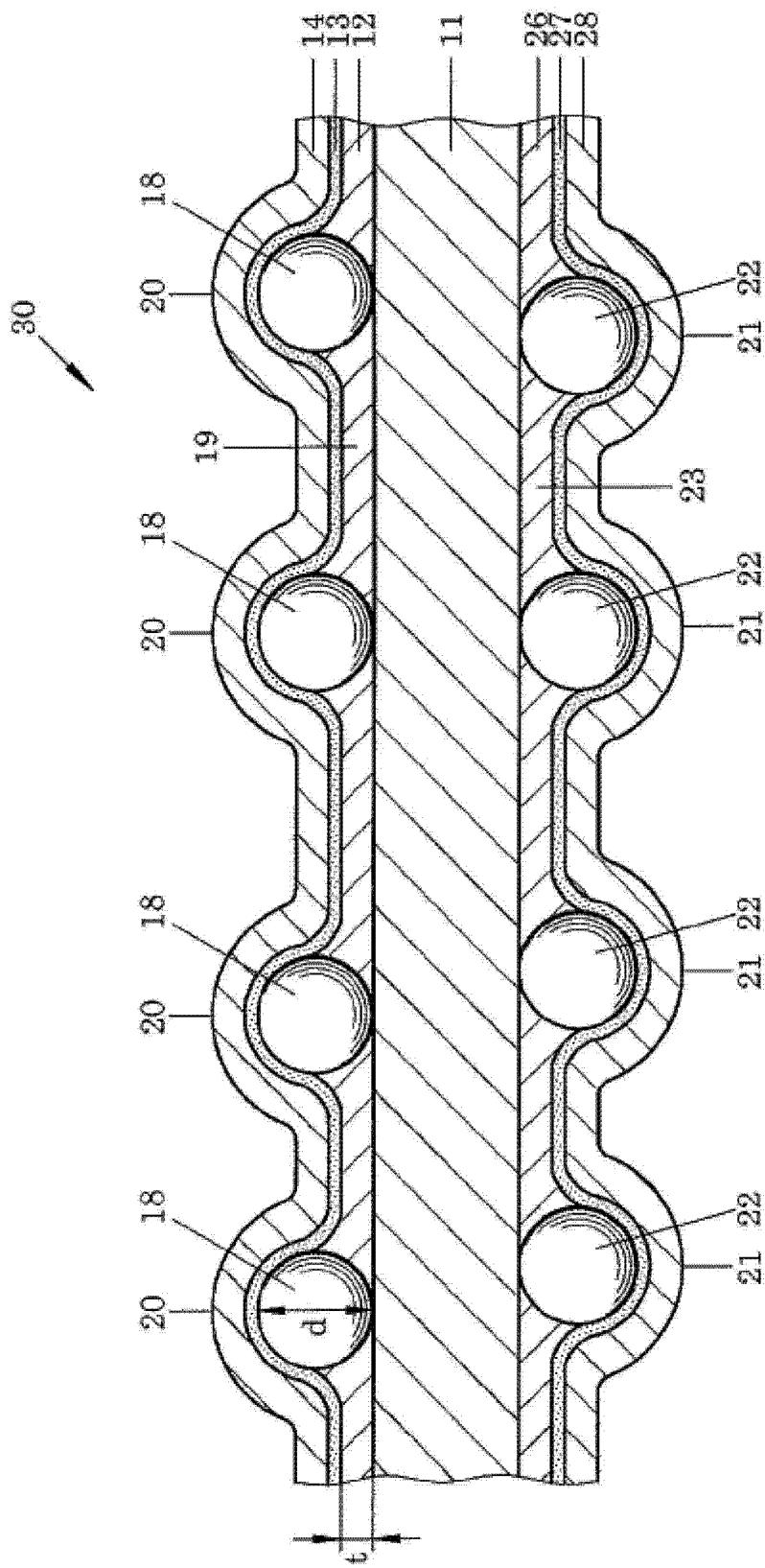


图 2

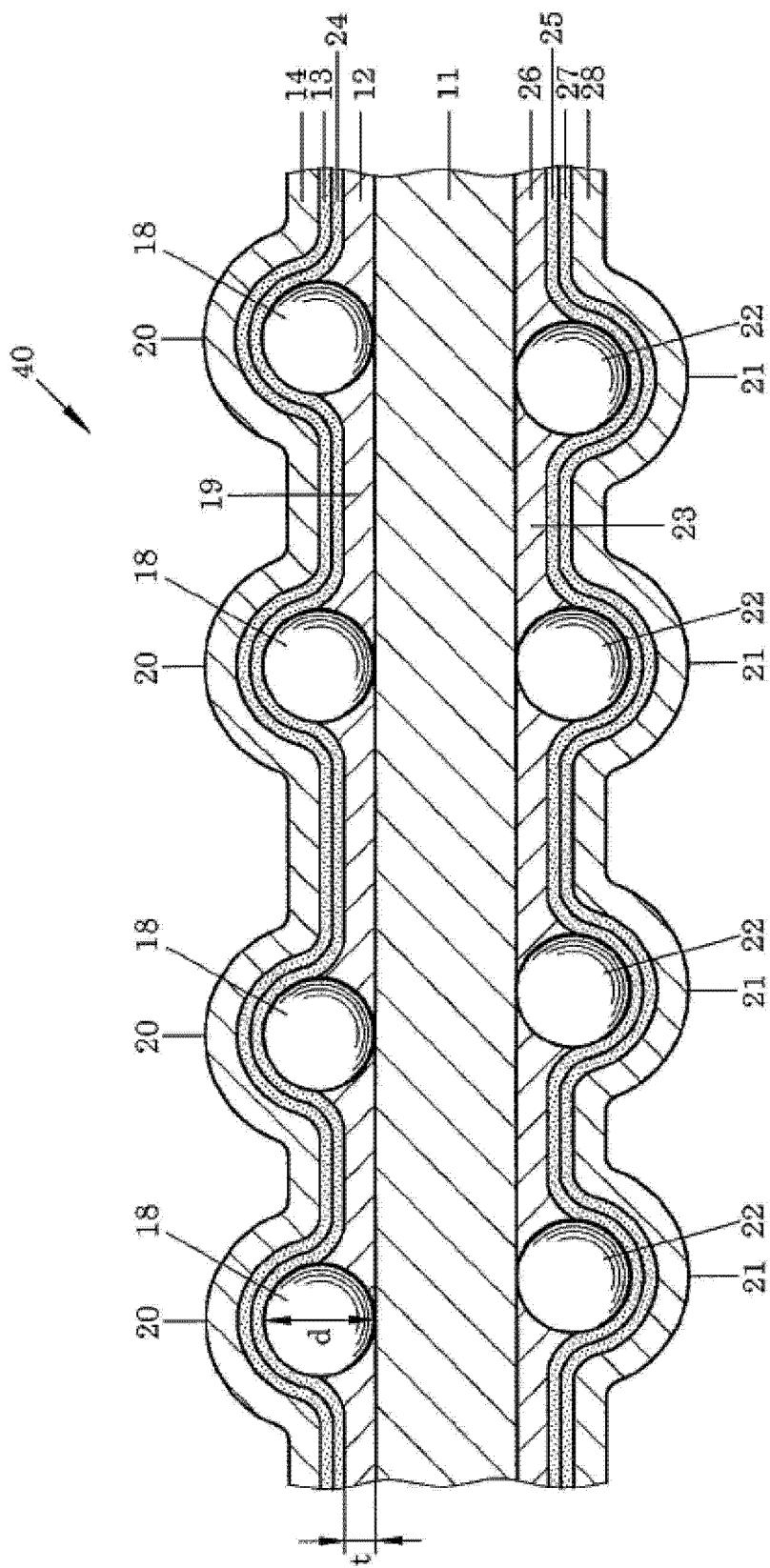


图 3